

高功率激光与光学

制备工艺对HfO₂薄膜抗激光损伤能力的影响

[马平](#) [柴林](#) [邱服民](#) [顾元元](#)

(成都精密光学工程研究中心, 四川 成都610041)

摘要: 采用反应蒸镀法沉积了单层HfO₂薄膜, 观察了薄膜表面主要的微结构缺陷, 研究了基片清洗工艺对薄膜损伤阈值的影响。测量了薄膜沉积前后表面粗糙度变化, 结果表明, 沉积工艺既可以增加也可以降低粗糙度, 并对薄膜抗激光损伤能力有较大的影响。

关键词: [HfO₂薄膜](#) [表面粗糙度](#) [激光损伤](#)

收稿日期

修回日期

通讯作者

DOI

分类号

相关文章([HfO₂薄膜](#)):

[制备工艺对HfO₂薄膜抗激光损伤能力的影响](#)

[沉积温度对HfO₂薄膜残余应力的影响](#)

[化学法制备的HfO₂薄膜的激光损伤阈值研究](#)

[\[PDF全文\]](#)

[\[HTML摘要\]](#)

[发表评论](#)

[查看评论](#)